

小型·低价格！简单操作”非接触”膜厚测量！

膜厚仪

Film Thickness Monitor

FE-300

特点

- 测试范围涵盖**薄膜到厚膜**
- 基于绝对反射率光谱分析膜厚
- **小型·低价**，精度高
- 无复杂设定，**操作简单**，短时间内即可上手
- 外观新颖，操作性提高
- 非线性最小二乘法，实现**光学常数解析**（
n：折射率、k：消光系数）

薄膜到厚膜的广领域对应
(10nm~1.5mm)



对应膜种

- 多层膜
- 非干涉膜
- 折射率倾斜
- 超晶格结构

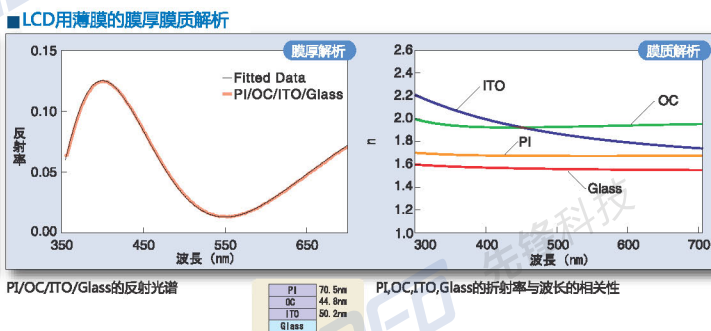
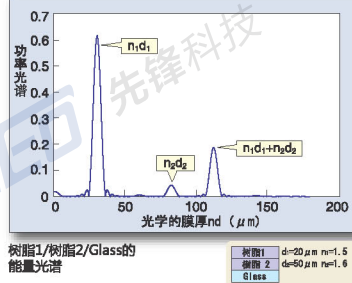
测量项目

- 绝对反射率测量
- 多层膜厚解析
- 光学常数解析 (n: 折射率 k: 消光系数)

用途

- 光学薄膜 (ARfilm、ITO等)
- FPD相关 (ITO、PI、PC、CF等)

测量实例



式样

型号	FE-300V	FE-300UV	FE-300NIR *1	
本体	标准型	薄膜型	厚膜型	厚膜型 (高分辨率)
样品尺寸	最大 8 寸晶圆 (厚度 5 mm)			
测量膜厚范围 (n d 值)	100 nm ~ 40 μm	10 nm ~ 20 μm	3 μm ~ 300 μm	15 μm ~ 1.5 mm
测量波长范围	450 nm ~ 780 nm	300 nm ~ 800 nm	900 nm ~ 1600 nm	1470 nm ~ 1600 nm
测量精度	± 0.2 nm 以内 *2	± 0.2 nm 以内 *2	-	-
重复精度	0.1 nm 以内 *3	0.1 nm 以内 *3	-	-
测量时间	0.1 s ~ 10 s 以内			
光斑直径	约 φ 3 mm			
光源	卤素灯	氙灯与卤素灯	卤素灯	卤素灯
通讯接口	USB			
尺寸, 重量	280 (W) × 570 (D) × 350 (H) mm、约 24 kg			
软件功能	波峰波谷解析、FFT解析、最适化法解析、最小二乘法解析			
标准	材料评价软件、薄膜模型解析软件、标准片解析			
选配功能	材料评价软件、薄膜模型解析软件、标准片解析			

*1 详细规格请咨询 *2 相对于VLSI公司产膜厚标准 (100nm SiO2/Si) 的膜厚证书记载的测量保证值范围
*3 VLSI公司产膜厚标准 (100nm SiO2/Si) 的同一反复测量时的扩张不确定度 (包括因子 2.1)